皮膜作製装置

フレーム溶射装置，粉体供給装置
データロガー

○フレーム溶射装置　：Metallisation製MK74
○粉体供給装置　：Metallisation製2007MF-PF
ホッパー容量：2.8L
供給量：1～40g/min(WA平均粒子径50μm換算)
（マスフローメータによるキャリアガス制御による）
搬送可能粒子径：5～60μm

○データロガー　：グラフテック（株）製GL7000Plus
K，R熱電対使用可能

溶射皮膜の例

溶射材料	気孔率	密着力	その他特性
α-Al_2O_3	5%以下	11MPa以上	炭素量0.1%以下
TiO_2	5%以下	11MPa以上	500Hv0.3以上
Ni-Cr	5%以下	12MPa以上	700Hv0.3以上
Ni/Cr-WC-Co	5%以下	12MPa以上	700Hv0.3以上

溶射ガス　：水素エチレン混合ガス（岩谷瓦斯㈱製ハイドロカットガス）
基材　：SS400(フジランダム＃24ブラスト)

KEIRIN.JP KEIRIN Official Website
JKA Social Action 競輪とオートレースの補助事業
※ 粉体供給装置及びデータロガーは，公益財団法人JKA「2020年度　公設工業試験研究所等が主体的に取組む共同研究補助事業」により導入しました。